## КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 621.315.592

Ю. В. Заикин Ю. А. Зарифьянц В. А. Лысков

## ЗАРЯЖЕНИЕ ЛОВУШЕК В ОКСИСУЛЬФАТНОЙ ПЛЕНКЕ НА МОНОКРИСТАЛЛЕ РЬЅ ПРИ ФОТОДЕСОРБЦИИ

В [1, 2] была исследована медленная релаксация проводимости реальной поверхности эпитаксиальных пленок PbS после возбуждения поперечным электрическим полем и оптическим заряжением ловушек. Представляло интерес провести аналогичные исследования в структуре термически выращенной оксисульфатной пленки PbS, являющейся удобной моделью для изучения электронных явлений в сложной гетерофазной поликристаллической системе — фоторезисторе, изготовленном высокотемпературной активацией пленки PbS на воздухе или в кислороде.

В настоящей работе измерения заряжения при оптическом возбуждении были выполнены на окисленной грани (100) монокристалла PbS с концентрацией носителей 6·10<sup>18</sup> см<sup>-3</sup> методом контактной разности потенциалов. Методика обработки поверхности, выращивания и измерения толщины оксисульфатного слоя изложены в [3].

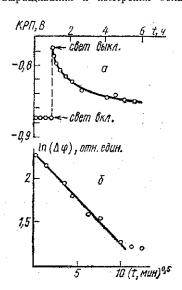


Рис. 1. а — изменение контактной разности потенциалов вакуумированного при 300 К монокристалла PbS с оксисульфатной пленкой и отсчетного электрода после облучения квантами с энергией ~2,3 эВ; б — начальный участок кинетики релаксации в координатах Коца [4]

Кристалл PbS с пленкой толщиной 0,5 мкм, выращенной окислением в кислороде при 870 K, помещался в ячейку для измерения контактной разности потенциалов с сетчатым отсчетным элетродом и вакуумировался при 300 K и давлении 5-10-6 мм рт. ст. в течение 3 ч. Далее производилась: засветка образца при 300 K ртутной

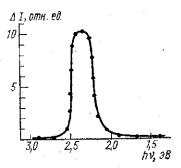


Рис. 2. Спектральное распределение относительной интенсивности выделения SO<sub>2</sub> при импульсных засветках

или ксеноновой лампой через фильтры. Если энергия кванта падающего света превышала 2,3 эВ, наблюдалось быстрое положительное заряжение поверхности образца  $\Delta \phi$  (инерционность схемы измерения контактной разности потенциалов  $\sim 1$  с), а в дальней-

шем релаксация контактной разности потенциалов к первоначальному значению (рис. 1,a). Начальный участок релаксационной кривой  $\Delta \phi(t)$  с приемлемой точностью аппроксимируется уравнением Коца [4]  $\Delta \phi(t) = \Delta \phi_0 \exp\left[-t (\tau^{5\phi})^{0.5}\right]$  с эффективным временем релаксации  $\tau_{0\phi} = 6 \cdot 10^3$  с (рис. 1, б). Такой кинетический закон характерен для перезарядки медленных поверхностных электронных состояний независимо от способа выведения их из равновесия с разрешенными зонами. При повторных засветках в вакууме величина  $\Delta \phi_0$  резко падала.

Полностью эффект заряжения поверхности восстанавливался только после многочасовой экспозиции образца в атмосфере при 300 К или кратковременного прогрева в кислороде при 500 К. При этом во всех последующих циклах длинноволновый порог фотовозбуждения смещался до 1,9 эВ. После вакуумирования образца при 500 К даже длительное облучение квантами света с энергией ниже 3,2 эВ т не приводило к изме-

нению краткой разности потенциалов с точностью до 5 МэВ.

Для выяснения возможной причины, вызывающей положительное заряжение поверхности оксисульфатной пленки при освещении, были проведены масс спектроскопические исследования газовыделения в результате засветки. Освещение производили импульсной лампой ИФП-200 через фильтры, состав газов анализировался прибором АПДП-2 и регистрировался кинокамерой. Не позднее чем через 0,1 с после вспышки в масс-спектре появлялись пики с массовыми числами 64, 48, 32 и соотношением амплитуд 1:0,75:0,25, которые однозначно идентифицируются как SO<sub>2</sub> (основной газообразный продукт взаимодействия поверхности PbS с кислородом [6]) и «осколочные» ионы SO и O2 (или S). Это было подтверждено контрольным напуском SO2 в систему.

На рис. 2 приведена спектральная зависимость относительной интенсивности пика SO<sub>2</sub>. Максимум на кривой характеризует энергетическое положение ловушек, заполнение которых при освещении вызывает выделение SO<sub>2</sub>. В результате последовательных засветок образца при фиксированной энергии квантов интенсивность этого пика экспоненциально падала с числом вспышек лампы. Общее количество выделившихся молекул составило  $\sim 10^{13}$  см $^{-2}$ . Если образец предварительно прогревался в вакууме при 500 K, выделения SO<sub>2</sub> при освещении не наблюдалось. Повторная экснозиция в атмосфере восстанавливала эффект, причем, как и при исследовании заряжения, длинноволновая граница смещалась (до 1,8 эВ). Имеющиеся данные пока не позволяют сделать вывод о том, находится ли SO<sub>2</sub> на поверхност да молекулярной форме или входит в нестабильные поверхностные комплексы, легко разлагающиеся за счет фотохимической реакции. Десорбция наблюдалась и при нагреве образца в интервале 420-470 К. Энергия активации термодесорбции, определенная методом «вспышки» [7], составила 1,6 эВ.

Сопоставление результатов электрофизических и масс-спектрометрических измерений, выполненных на одних и тех же образцах, приводит к выводу, что причиной положительного заряжения поверхности оксисульфатного слоя на PbS при освещении является десорбция SO<sub>2</sub>. Независимо от конкретных форм связи SO<sub>2</sub> с поверхностью в результате десорбции происходит быстрое перераспределение заряда между поверхностью и объемом пленки. Это в свою очередь выводит из равновесия систему электронных состояний пленки, заряд в которых после возбуждения медленно релаксирует к исходному значению. Если в аналогичных условиях проводился опыт со стандартным вакуумированным PbS-фоторезистором, после выключения освещения наблюдалась медленная релаксация его проводимости. Интересно отметить, что времена релаксации заряда на реальной поверхности PbS (находившейся в контакте с атмосферой при 300 К) и поверхности, покрытой толстой оксисульфатной пленкой, оказались очень близкими.

Авторы выражают благодарность проф. В. Ф. Киселеву за интерес к работе и обсуждение результатов.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. Муртазин А. М., Зарифьянц Ю. А. «Физика и техника полупроводников», 1**9**73, **7**, 2041.
- 2. Муртазин А. М., Зарифьянц Ю. А. «Физика и техника полупроводников», 1976, 10, 547.
- 3. Заикин Ю. В., Зарифьянц Ю. А., Зломанов В. П. «Изв. вузов. Физика», 1976, № 2, 75.
- Кос S. «J. Phys. Crech.», 1961, В11, 193.
   Заикин Ю. В., Карягин С. Н., Зарифьянц Ю. А., Киселев В. Ф. «Физика и техника полупроводников», 1976, 10, 2221.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Облучение такого образца более энергичными квантами приводит к отрицательпому заряжению и эффекту фотопамяти [5].

6. Hillenbrand L. J. «J. Phys. Chem.», 1969, 73, 2902. 7. Агеев В. Н., Ионов Н. И., Устинов Ю. К. «Журнал технической физики», 1964, 34, 547.

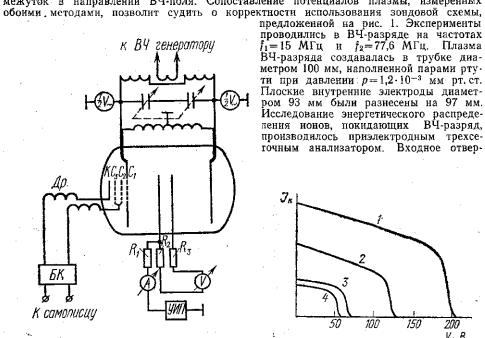
> Поступила в редакцию 20.10 1976 г. Кафедра общей физики для химфака

УДК 533.9.082.76

В. А. Годяк C. H. OKC

## к вопросу о зондовой диагностике вч-плазмы

Корректное применение зондовой методики для диагностики плазмы ВЧ-разряда требует принятия специальных мер по установлению ВЧ-составляющей разности по-тенциалов в призондовом слое [1]. Известно, что наличие ВЧ-составляющей напря-жения в призондовом слое приводит к сдвигу вольтамперной характеристики в сторону отрицательных потенциалов, т. е. к кажущемуся уменьшению постоянного потенциала плазмы в ВЧ-разрядах. В работе [2] была предложена зондовая схема, позволяющая исключить проникновение ВЧ-напряжения в призондовый слой. В настоящем исследовании проведена независимая проверка эффективности этой схемы. Для этого помимо зондовых измерений потенциала плазмы по методике [2] потенциал плазмы определялся из интегральных энергетических спектров ионов, покидающих разрядный промежуток в направлении ВЧ-поля. Сопоставление потенциалов плазмы, измеренных



ти при давлении  $p=1,2\cdot 10^{-3}$  мм рт. ст. Плоские внутренние электроды диаметром 93 мм были разнесены на 97 мм. Исследование энергетического распредепения ионов, покидающих ВЧ-разряд, производилось приэлектродным трехсеточным анализатором. Входное отвер-

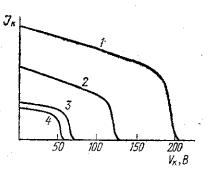


Рис. 1. Схема экспериментальной установки. Др — высокочастотный дроссель, BK — блок коммутаций  $R_1 = R_2 = R_3 =$ =160 кОм

Рис. 2. Интегральные энергетичеопектры ионов при  $f_1 = M\Gamma_{\Pi}$ :  $1-V\sim =420$  2—  $V\sim =250~{
m B}$  и при  $f_2=77.6~{
m M}$  Гц;  $3-V\sim =565,~4-V\sim =28,2~{
m B}$ 

стие анализатора имело диаметр 6 мм, ширина ячейки сетки была 0,32 мм и толщина проволочки — 0,05 мм. Расстояние между входным отверстием анализатора и коллектором 4 мм, а между сетками 1 мм. Анализ велся по коллектору K. Сетки  $C_2$  и  $C_3$ 

ВМУ, № 5, физика, астрономия